

鹏城半导体 LPCVD设备 PC-007

产品名称	鹏城半导体 LPCVD设备 PC-007
公司名称	鹏城半导体技术（深圳）有限公司
价格	.00/面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号 南山智园崇文园区3号楼304（注册地址）
联系电话	13632750017

产品详情

小型管式LPCVD设备简介

LPCVD是在低压高温的条件下，通过化学反应气相外延的方法在衬底上沉积各种功能薄膜（主要是Si₃N₄、SiO₂及Poly硅薄膜）。可用于科学研究、实践教学、小型器件制造。

设备结构及特点

1、小型化，方便实验室操作和使用，大幅降低实验成本

两种基片尺寸2英寸或4英寸；每次装片1~3片。

基片放置方式：配置三种基片托架，竖直、水平卧式、带倾角。

基片形状类型：不规则形状的散片、 2~4英寸标准基片。

2、设备为水平管卧式结构

由石英管反应室、隔热罩炉体柜、电气控制系统、真空系统、气路系统、温控系统、压力控制系统及气瓶柜等系统组成。

反应室由高纯石英制成，耐腐蚀、抗污染、漏率小、适合于高温使用；
设备电控部分采用了先进的检测和控制系统，量值准确，性能稳定、可靠。

设备主要技术指标

成膜类型 Si₃N₄、Poly-Si、SiO₂等

最高温度 1200

恒温区长度 根据用户需要配置

恒温区控温精度 ± 0.5

工作压强范围 13 ~ 1330Pa

膜层不均匀性 $\pm 5\%$

基片每次装载数量 标准基片:1 ~ 3片;不规则尺寸散片:若干

压力控制 闭环充气式控制

装片方式 手动进出样品

生产型LPCVD设备简介

设备功能

该设备是在低压高温的条件下，通过化学反应气相外延的方法在衬底上沉积各种功能薄膜（主要是Si₃N₄、SiO₂及Poly硅薄膜）。

可提供相关镀膜工艺。

设备结构及特点：

设备为水平管卧式结构，由石英管反应室、隔热罩炉体柜、电气控制系统、真空系统、气路系统、温控系统、压力控制系统及气瓶柜等系统组成。

整个工艺过程由计算机对全部工艺流程进行管理，实现炉温、气体流量、压力、阀门动作、泵的启闭等工艺参数进行监测和自动控制。也可以手动控制。

成膜类型Si₃N₄、Poly-Si、SiO₂等

基片每次装载数量 100片

设备总功率 16kW

冷却水用量 2m³/h

装片方式 悬臂舟自动送样

LPCVD软件控制界面